

بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسى مقاله :

گذردهی عظیم دی الکتریک با اتلاف کم

در سرامیک های SnO2 روتیل کودوپ شده با (Al+Nb) در دمای اتاق

عنوان انگلیسی مقاله :

Colossal dielectric permittivity in (Al 1 Nb) co-doped rutile

SnO2 ceramics with low loss at room temperature



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل

با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، <mark>اینجا</mark> کلیک *ن*ایید.

فروشگاه اینترنتی ایران عرضه

بخشی از ترجمه مقاله



بخشی از ترجمه مقاله

Doped SnO2 was investigated as a kind of varistor with insulating grain boundaries and semi-conducting grains, sim-ilar to CCTO and doped TiO2 ceramics in which CP was discovered.24–27 CP was also observed in doped SnO2 ceramics; however, CP can only be observed at low frequencies in ZnþCo co-doped SnO2 ceramics.28 Nb doping can generate n-type carriers that can result in CP and high dielectric loss in tetravalent oxides. Trivalent cation doping can be considered acceptor doping and can capture the electrons introduced by Nb doping in tetravalent oxides. As a result, the concentration of carriers can be acutely tuned by adjust-ing the ratio between Nb and trivalent cations, which will result in different grain and grain boundary resistances for co-doped tetravalent oxides.29,30 Therefore co-doped SnO2 may be a type of CP material with low dielectric loss.

SnO₂ دوپ شده به عنوان نوعی متغیرساز^۲ دارای مرز دانه های مجزا و دانه های نیمه رسانا، مشابه با CCTO و سرامیک-های TiO₂ دوپ شده که در آن CP کشف شد، مورد بررسی قرار گرفت. CP همچنین در سرامیک های SnO₂ دوپ شده مشاهده شد؛ با این حال، CP را تنها میتوان در فرکانس های پایین در سرامیک های SnO₂ کو دوپ شده با Cn+co مشاهده کرد. دوپ کردن Nb میتواند حامل های نوع n را تولید کرده که این امر منجر به ایجاد CP و اتلاف بالای دی الکتریک در اکسیدهای چهار ظرفیتی می شود. دوپ کردن کاتیون سه ظرفیتی را میتوان به عنوان دوپ کردن پذیرنده در نظر گرفت که میتواند الکترون های ایجاد شده به وسیله ی دوپ کردن dN در اکسیدهای چهار ظرفیتی را جذب کند. در نظر گرفت که میتواند الکترون های ایجاد شده به وسیله ی دوپ کردن dN در اکسیدهای چهار ظرفیتی را جذب کند. تفاوت در مقاومت های مرز دانه و دانه برای اکسیدهای چهار ظرفیتی کو دوپ شده خواهد شد. بنابراین SnO کو دوپ شده ممکن است نوعی از ماده PC دارای اتلاف کم دی الکتریک باشد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، <mark>اینجا</mark> کلیک *خ*ایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، <mark>اینجا</mark> کلیک ن*ه*ایید.

بخشی از ترجمه مقاله

فروشگاه اینترنتی ایران عرضه